

ISPlasma2010
第2回先進プラズマ科学と窒化物及びナノ材料への応用に関する
国際シンポジウムプログラム

3/7(日)	3/8(月)			3/9(火)			3/10(水)		
	受付 (9:00-9:20)			受付 (9:00-9:20)			受付 (9:00-9:20)		
開会式・特別講演【A会場】	(9:20-9:35) 開会の辞	(9:20-9:50) 基調講演 9a-A01KA M. Goekner (テキサス大学ダラス校、アメリカ) "Plasma-Surface Interactions-temperature Affects"	(9:20-9:50) 基調講演 9a-B01KB Y. Cordier (CRHEA-CNRS, フランス) "Comparison of GaN Based Structures Grown by Molecular Beam Epitaxy Using Nitrogen Plasma and Ammonia Sources"	(9:20-9:50) 基調講演 9a-C01KC 福住 俊一(大阪大学) "Nanomaterials for Artificial Photosynthesis"	(9:20-9:50) 基調講演 10a-A01KA R. d'Agostino (パリア大学、イタリア) "Plasma Nanostructured Fluoro-Polymers"	(9:20-9:50) 基調講演 10a-B01KB 太田 光一(豊田合成(株)) "History of GaN LED and its Progress"	(9:20-9:50) 基調講演 10a-C01KC L. A. Rocha (ミネソタ大学、ポルトガル) "Functionalization of Ti Surfaces for Biomedical Applications"	(9:20-9:50) 基調講演 10a-C02OC E. Miura-Fujiwara (Nagoya Institute of Technology) "Fabrication of Metal-based Functionally Graded Grinding Wheel Dispersing Fine Ceramic Particles by a Centrifugal Mixed-powder Method"	(9:20-9:50) 基調講演 10a-C03OC M. Tokita (Bits Company Limited) "Development of Industrial Products on Functionally Graded Materials by Spark Plasma Sintering (SPS) Method"
	(9:35-9:45) 事業総括(財団法人科学技術交流財団) "Tokai Region Nanotechnology Manufacturing Cluster and its Expansion Program"	(9:50-10:10) 9a-A02OA S. Barnola (CEA-LETI-MINATEC) "Challenges in Plasma Etching of Narrow 3D Gate All Around Devices"	(9:50-10:10) 9a-B02OB T. Ohachi (Doshisha University) "RF Nitrogen Source for MBE Growth of Group III Nitrides on Si and its Application for AM-MEE"	(9:50-10:10) 招待講演 9a-C02IC 吉田 司(岐阜大学) "Electrochemical Self-Assembly of Nanostructured ZnO/Dye Hybrid Thin Films for Solar Cells"	(9:50-10:20) 基調講演 10a-A02KA U. R. Kortshagen (ミネソタ大学、アメリカ) "Plasma Synthesis of Silicon Inks and their Applications for Renewable Energy Solutions"	(9:50-10:10) 招待講演 10a-B02IB V. Haerle (OSRAM, ドイツ) "LED Technology for New Applications"	(10:10-10:30) 10a-B03OB C.-C. Kao (National Cheng Kung University) "Localized Surface Plasmon-Enhanced GaN-based Light-Emitting-Diode with Ag Nanotriangles Array by Nanosphere Lithography"	(10:10-10:30) 10a-C03OC M. Tokita (Bits Company Limited) "Development of Industrial Products on Functionally Graded Materials by Spark Plasma Sintering (SPS) Method"	(10:10-10:30) 10a-C03OC M. Tokita (Bits Company Limited) "Development of Industrial Products on Functionally Graded Materials by Spark Plasma Sintering (SPS) Method"
(9:45-10:15) Plenary Lecture 8a-A01S 飯島 澄男(名城大学) "Structure Characterization of Nano-carbon Materials on the Atomic Resolution Basis"	(10:10-10:30) 9a-A03OA S.-W. Cho (Korea AjouUniversity) "Effect of CH2F2 Addition on the Angular Dependence of Si3N4 Etch Rates and SiO2-to-Si3N4 Etch Selectivity in a C4F6/Ar/O2 Plasma"	(10:10-10:30) 9a-B03OB S. Chen (Nagoya University) "Radical Kinetics in N2-H2 Plasma Generated by Novel High Density Radical Source"	(10:10-10:30) 9a-C03OC S. Adhikari (Chubu University) "Both Single Walled and Multi Walled Carbon Nanotubes Incorporated Organic Solar Cells"	(10:20-10:40) 招待講演 10a-A03IA 吉田 豊信(東京大学) "Toward a direct production of wafer-equivalent Si films by mesoplasma CVD"	(10:10-10:30) 10a-B03OB C.-C. Kao (National Cheng Kung University) "Localized Surface Plasmon-Enhanced GaN-based Light-Emitting-Diode with Ag Nanotriangles Array by Nanosphere Lithography"	(10:10-10:30) 10a-C03OC M. Tokita (Bits Company Limited) "Development of Industrial Products on Functionally Graded Materials by Spark Plasma Sintering (SPS) Method"	(10:10-10:30) 10a-C03OC M. Tokita (Bits Company Limited) "Development of Industrial Products on Functionally Graded Materials by Spark Plasma Sintering (SPS) Method"	(10:10-10:30) 10a-C03OC M. Tokita (Bits Company Limited) "Development of Industrial Products on Functionally Graded Materials by Spark Plasma Sintering (SPS) Method"	
	(10:15-10:35) 休憩			(10:30-10:50) 休憩			(10:40-10:50) 休憩		
東海広域ナノテクものづくりクラスター創成事業(第二期)	(10:35-11:00) 知的クラスター講演 8a-A02C 堀 勝(名古屋大学) "Fundamental Research on Plasma Nanoprocessing"	(10:50-11:20) 基調講演 9a-A04KA J. P. Chang (カリフォルニア大学、アメリカ) "Multifunctional Oxide Materials: Synthesis and Patterning"	(10:50-11:20) 基調講演 9a-B04KB B. Daudin (CEA グルノーブル研究所、フランス) "Growth, Structural and Optical Properties of GaN/AlN Nanowire Heterostructures"	(10:50-11:20) 基調講演 9a-C04KC J. Patscheider (EMPA, スイス) "Hard and Optically Transparent Al-Si-N Thin Films: Solid Solutions, Nanocomposites and Nanomultilayers"	(10:50-11:20) 基調講演 10a-A04KA 高本 達也(シャープ(株)) "High Efficiency III-V Multijunction Solar Cells"	(10:50-11:20) 基調講演 10a-B04KB C. J. Sun (ITRI, 台湾) "UV WLED for Wide Color Gamut Display Application"	(10:50-11:20) 基調講演 10a-C04KC P. Milani (ミラノ大学、イタリア) "Pulsed Microplasma Cluster Source: A Powerful Tool for the Integration of Nanomaterials on Microdevices"	(10:50-11:20) 基調講演 10a-C04KC P. Milani (ミラノ大学、イタリア) "Pulsed Microplasma Cluster Source: A Powerful Tool for the Integration of Nanomaterials on Microdevices"	(10:50-11:20) 基調講演 10a-C04KC P. Milani (ミラノ大学、イタリア) "Pulsed Microplasma Cluster Source: A Powerful Tool for the Integration of Nanomaterials on Microdevices"
	(11:00-11:15) 知的クラスター講演 8a-A03C 天野 浩(名城大学) "Comparative Study on the Growth of Group III Nitrides by Plasma-MBE and MOVPE"	(11:20-11:40) 9a-A05OA T. Kachi (Toyota Central R&D Labs., Inc.) "Suppression of Leakage Current through the pn Junction Fabricated on Etched Surfaces of GaN"	(11:20-11:40) 9a-B05OB H. Umeda (Ritsumeikan University) "Fabrication of InN/InGaN Multi Quantum Well Structures by Droplet Elimination by Radical-beam Irradiation"	(11:20-11:40) 招待講演 9a-C05IC 小駒 益弘(上智大学) "Surface Treatment of Fine Powders Using Atmospheric Pressure Glow Discharge"	(11:20-11:40) 10a-A05OA M. Umemo (Chubu University) "Synthesis of Carbon Thin Film for Solar Cells Application"	(11:20-11:40) 10a-B05OB Y. Sakai (Nagoya Institute of Technology) "MOCVD Growth and Characterization of AlInN-based Schottky Ultraviolet Photodiodes on AlN Template"	(11:20-11:40) 10a-C05OC K. Sumiyama (Nagoya Institute of Technology) "Fe-Si Core/Si Shell Clusters Prepared by Collisions of Fe and Si Clusters in a Plasma-Gas-Condensation System"	(11:20-11:40) 10a-C05OC K. Sumiyama (Nagoya Institute of Technology) "Fe-Si Core/Si Shell Clusters Prepared by Collisions of Fe and Si Clusters in a Plasma-Gas-Condensation System"	(11:20-11:40) 10a-C05OC K. Sumiyama (Nagoya Institute of Technology) "Fe-Si Core/Si Shell Clusters Prepared by Collisions of Fe and Si Clusters in a Plasma-Gas-Condensation System"
	(11:15-11:30) 知的クラスター講演 8a-A04C 江川 孝志(名古屋工業大学) "Growth and Device Application of GaN on Si"	(11:40-12:00) 9a-A06OA C. S. Moon (Nagoya University) "A Well-Established Compact Combinatorial Etching Process Employing Inductively Coupled H2/N2 Plasma"	(11:40-12:00) 9a-B06OB J. L. Guyaux (RIBER SA) "Current and Future's Development of Thin Film Technology"	(11:40-12:00) 9a-C06OC J. Musil (University of West Bohemia) "Hard Nanocomposite Coatings: Mechanical and Tribological Properties, Thermal Stability and Protection against Oxidation above 1000 °C"	(11:40-12:00) 10a-A06OA Y. Kawashima (Kyushu University) "Synthesis of Crystalline Si Nanoparticles for Quantum Dots Sensitized Solar Cells"	(11:40-12:00) 10a-B06OB F. Matsuno (Toyoashi University of Technology) "Intelligent UV Sensor Composed of GaN-based Photodiode and Si-charge Transfer Type Signal Processor"	(11:40-12:00) 10a-C06OC H. Miyata (Kyusyu University) "Control of Surface Roughness of Nano-particle Composite Lowk Film Deposited in CVD Plasma"	(11:40-12:00) 10a-C06OC H. Miyata (Kyusyu University) "Control of Surface Roughness of Nano-particle Composite Lowk Film Deposited in CVD Plasma"	(11:40-12:00) 10a-C06OC H. Miyata (Kyusyu University) "Control of Surface Roughness of Nano-particle Composite Lowk Film Deposited in CVD Plasma"
	(11:30-11:45) 知的クラスター講演 8a-A05C 高井 治(名古屋大学) "Progress in Solution Plasma Processing"								
	(11:45-12:00) 知的クラスター講演 8a-A06C 渡辺 義見(名古屋工業大学) "Development of Nanocomposites Based on Interface Engineering"								
	(12:00-13:00) ランチ			(12:00-13:00) ランチ			(12:00-13:00) ランチ		
	(13:00-14:30) ポスターセッション A			(13:00-14:30) ポスターセッション B			(13:00-14:30) ポスターセッション B		
(14:00-17:00) 展示の搬入	(14:30-15:00) 基調講演 8p-A01KA U. Ozaratzki (Jülich大学ポッフム校、ドイツ) "The Optical Probe: A Novel Device for Spatially Resolved Optical Emission Spectroscopy in Plasmas"	(14:30-14:50) 招待講演 8p-B01IB S. Arulkumaran (シンヤン工科大学、シンガポール) "High Performance AlGaIn/AlN/GaN High-Electron-Mobility Transistors on Silicon Substrate"	(14:30-15:00) 基調講演 8p-C01KC J. Robertson (ケンブリッジ大学、イギリス) "Plasma Deposition of Diamond-like Carbon Films"	(14:30-15:00) 基調講演 9p-A01KB 野田 進(京都大学) "Photonic Crystals and Their Application to GaN System"	(14:30-15:00) 基調講演 10p-A01KA 東 哲郎(東京エレクトロン(株)) "Global Competitive Strength by Core Technology" "コア技術を国際競争力に結びつけるために"	(14:30-15:00) 基調講演 10p-A01KA 東 哲郎(東京エレクトロン(株)) "Global Competitive Strength by Core Technology" "コア技術を国際競争力に結びつけるために"	(14:30-15:00) 基調講演 10p-A01KA 東 哲郎(東京エレクトロン(株)) "Global Competitive Strength by Core Technology" "コア技術を国際競争力に結びつけるために"	(14:30-15:00) 基調講演 10p-A01KA 東 哲郎(東京エレクトロン(株)) "Global Competitive Strength by Core Technology" "コア技術を国際競争力に結びつけるために"	
	(15:00-15:20) 8p-A02OA K. Urabe (Kyoto University) "Spatial Distribution of Electron Density in a Parallel-plate Dielectric Barrier Discharge Measured by CO2-laser Heterodyne Interferometry"	(14:50-15:10) 招待講演 8p-B02IB 橋詰 保(北海道大学) "Effects of plasma processing on Surface Properties of GaN and AlGaIn"	(15:00-15:20) 依頼講演 8p-C02TC H. Ohara (Nippon ITF Inc.) "Industrial Applications of DLC and their Scientific Aspects"	(15:00-15:30) 基調講演 9p-A02KB N. Grandjean (ローザンヌ工科大学、スイス)	(15:00-15:30) 基調講演 10p-A02KA J. G. Han (成均館大学、韓国) "Synthesis of Functional Hybrid Films on Polymer by Dual RF Plasma CVD"	(15:00-15:30) 基調講演 10p-A02KA J. G. Han (成均館大学、韓国) "Synthesis of Functional Hybrid Films on Polymer by Dual RF Plasma CVD"	(15:00-15:30) 基調講演 10p-A02KA J. G. Han (成均館大学、韓国) "Synthesis of Functional Hybrid Films on Polymer by Dual RF Plasma CVD"	(15:00-15:30) 基調講演 10p-A02KA J. G. Han (成均館大学、韓国) "Synthesis of Functional Hybrid Films on Polymer by Dual RF Plasma CVD"	
	(15:20-15:40) 8p-A03OA C. Koshimizu (TOKYO ELECTRON AT LTD.) "Temperature Measurement of Silicon Wafer in Plasma Etching Process Using Low-coherence Interferometry"	(15:10-15:30) 8p-B03OB S. Nakamura (Tokyo Metropolitan University) "Electrical and Optical Characterization of Plasma-Induced Defects in n-type GaN Exposed to Plasma"	(15:20-15:40) 依頼講演 8p-C03TC M. Hasegawa (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology) "Low Temperature Nano-crystalline Diamond Film Synthesis Using Surface Wave Plasma Chemical Vapor Deposition"	(15:30-16:00) 基調講演 9p-A03KB U. K. Mishra (カリフォルニア大学サンタバーバラ校、アメリカ) "The Use of Plasma in the Growth and the Processing of Gallium Nitride Materials"	(15:30-16:00) 基調講演 10p-A03KA E. Schultheiss (フ라운ホーファー研究所、ドイツ) "Technology Transfer in Germany; the Fraunhofer Model"	(15:30-16:00) 基調講演 10p-A03KA E. Schultheiss (フ라운ホーファー研究所、ドイツ) "Technology Transfer in Germany; the Fraunhofer Model"	(15:30-16:00) 基調講演 10p-A03KA E. Schultheiss (フ라운ホーファー研究所、ドイツ) "Technology Transfer in Germany; the Fraunhofer Model"	(15:30-16:00) 基調講演 10p-A03KA E. Schultheiss (フ라운ホーファー研究所、ドイツ) "Technology Transfer in Germany; the Fraunhofer Model"	
	(15:40-16:00) 8p-A04OA Q. Zhang (Chubu University) "Plasma Electron Monitoring with Multi-Resonator Frequency Shift Probe"	(15:30-15:50) 8p-B04OB S. L. Selvaraj (Nagoya Institute of Technology) "Improved Breakdown by Suppressing Gate Leakage Using 2nm i-GaN Cap Layered AlGaIn/GaN HEMTs on Silicon"	(15:40-16:00) 依頼講演 8p-C04TC H. Yamada (AIST) "A Description of Reactive Microwave-plasma-CVD of Single-crystal-diamond"	(16:00-16:20) 招待講演 9p-A04IB 上杉 勉(豊田中央研究所) "GaN Power Switching Devices for Automotive Applications"	(16:00-16:30) 基調講演 10p-A04KA 泉谷 渉 ((株)産業タイムズ社) "Environment and Energy is the Second Industrial Revolution!"	(16:00-16:30) 基調講演 10p-A04KA 泉谷 渉 ((株)産業タイムズ社) "Environment and Energy is the Second Industrial Revolution!"	(16:00-16:30) 基調講演 10p-A04KA 泉谷 渉 ((株)産業タイムズ社) "Environment and Energy is the Second Industrial Revolution!"	(16:00-16:30) 基調講演 10p-A04KA 泉谷 渉 ((株)産業タイムズ社) "Environment and Energy is the Second Industrial Revolution!"	
	(16:00-16:20) 休憩	(15:50-16:20) 休憩	(16:00-16:20) 休憩	(16:20-16:40) 休憩	(16:30-16:50) 休憩	(16:30-16:50) 休憩	(16:30-16:50) 休憩	(16:30-16:50) 休憩	
プラズマ②【A会場】 シミュレーション	(16:20-16:50) 基調講演 8p-A05KA M. J. Kushner (シンガポール工科大学、アメリカ) "Customizing Plasma Sources for Advanced Materials Synthesis"	(16:20-16:50) 基調講演 8p-B05KB 福田 承生(東北大学) "Prospects for the Acidic Ammonothermal Growth of GaN Crystal"	(16:20-16:50) 基調講演 8p-C05KC Y. Wu (国立シンガポール工科大学、シンガポール) "Growth of Two-dimensional Carbon Nanostructures and their Electrical Transport Properties"	(16:40-18:10) パネルディスカッション ~Application of Advanced Plasma Technology for Nitride Semiconductors~ <モデレーター>名西 徳之(立命館大学)	(16:50-18:20) パネルディスカッション ~Application Front of Advanced Plasma Science and Industry-Academia-Government Collaboration~ <モデレーター> 泉谷 渉 ((株)産業タイムズ社)	(16:50-18:20) パネルディスカッション ~Application Front of Advanced Plasma Science and Industry-Academia-Government Collaboration~ <モデレーター> 泉谷 渉 ((株)産業タイムズ社)	(16:50-18:20) パネルディスカッション ~Application Front of Advanced Plasma Science and Industry-Academia-Government Collaboration~ <モデレーター> 泉谷 渉 ((株)産業タイムズ社)	(16:50-18:20) パネルディスカッション ~Application Front of Advanced Plasma Science and Industry-Academia-Government Collaboration~ <モデレーター> 泉谷 渉 ((株)産業タイムズ社)	
	(16:50-17:10) 8p-A06OA A. Ito (National Institute for Fusion Science) "Molecular Dynamics Simulation of Chemical Sputtering and Chemical Vapor Deposition on Carbon Materials"	(16:50-17:10) 8p-B06OB H. Y. Geng (FURUKAWA CO., LTD) "Residual Strain Evaluation by Cross-sectional Micro-reflectance Spectroscopy of Freestanding GaN Grown by HVPE"	(16:50-17:10) 招待講演 8p-C06IC 野崎 智洋(東京工業大学) "A Pressure-induced Transition of Carbon Nanotube Morphology in Plasma Enhanced CVD"	(16:40-18:10) パネルディスカッション ~Application of Advanced Plasma Technology for Nitride Semiconductors~ <モデレーター>名西 徳之(立命館大学)	(16:50-18:20) パネルディスカッション ~Application Front of Advanced Plasma Science and Industry-Academia-Government Collaboration~ <モデレーター> 泉谷 渉 ((株)産業タイムズ社)	(16:50-18:20) パネルディスカッション ~Application Front of Advanced Plasma Science and Industry-Academia-Government Collaboration~ <モデレーター> 泉谷 渉 ((株)産業タイムズ社)	(16:50-18:20) パネルディスカッション ~Application Front of Advanced Plasma Science and Industry-Academia-Government Collaboration~ <モデレーター> 泉谷 渉 ((株)産業タイムズ社)	(16:50-18:20) パネルディスカッション ~Application Front of Advanced Plasma Science and Industry-Academia-Government Collaboration~ <モデレーター> 泉谷 渉 ((株)産業タイムズ社)	
(17:00-18:00) 受付	(17:10-17:30) 8p-A07OA H. Kousaka (Nagoya University) "Numerical Simulation of High-density Plasma Column Sustained in Narrow Metal Tube with Microwave Propagation along Plasma-sheath Interface"	(17:10-17:30) 8p-B07OB D. Iida (Meijo University) "Growth of GaInN Films by Raised Pressure MOVPE System at 200kPa"	(17:10-17:30) 8p-C07OC S. C. Chen (National Cheng Kung University) "Magneto-optical Properties of Armchair Nanographene Ribbons under the Modulated Electric Field"	(16:40-18:10) パネルディスカッション ~Application of Advanced Plasma Technology for Nitride Semiconductors~ <モデレーター>名西 徳之(立命館大学)	(16:50-18:20) パネルディスカッション ~Application Front of Advanced Plasma Science and Industry-Academia-Government Collaboration~ <モデレーター> 泉谷 渉 ((株)産業タイムズ社)	(16:50-18:20) パネルディスカッション ~Application Front of Advanced Plasma Science and Industry-Academia-Government Collaboration~ <モデレーター> 泉谷 渉 ((株)産業タイムズ社)	(16:50-18:20) パネルディスカッション ~Application Front of Advanced Plasma Science and Industry-Academia-Government Collaboration~ <モデレーター> 泉谷 渉 ((株)産業タイムズ社)	(16:50-18:20) パネルディスカッション ~Application Front of Advanced Plasma Science and Industry-Academia-Government Collaboration~ <モデレーター> 泉谷 渉 ((株)産業タイムズ社)	
	(18:00-19:30) ウェルカムパーティー (名城大学 学生ホール)	(17:30-19:00) ポスターセッション A			(18:10-19:40) パンケット(名城大学 名城食堂)			(18:20-18:30) 閉会の辞	
							(18:30-19:30) 展示の搬出		